#### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-336313 (P2000-336313A)

(43)公開日 平成12年12月5日(2000.12.5)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	i	<mark>微別記号</mark>	F I	テ	-マコード(参考)
C 0 9 D 1	83/04		C 0 9 D 183/04		2H048
G 0 2 B	1/10		G 0 2 B 5/28		2 K 0 0 9
	1/11		1/10	Z	4 J 0 3 8
	5/28			Α	

審査請求 未請求 請求項の数5 〇L (全 5 頁)

(21)出願番号 特願平11-153626 (71)出願人 000003193

(22)出願日 平成11年6月1日(1999.6.1) 東京都台東区台東1丁目5番1号

(72)発明者 吉原 俊昭

東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印

刷株式会社内

凸版印刷株式会社

Fターム(参考) 2HO48 GA05 GA11 GA27

2K009 BB28 CC24 CC35 CC42 CC45

DD02 DD05

4J038 DG262 DL022 DL032 DM021 FA212 GA01 GA03 HA216

JA23 JC32 KA20 MA14 NA19

PC03 PC08

## (54) 【発明の名称】 高屈折率コーティング組成物

#### (57)【要約】

【課題】高い屈折率を有し、かつ硬度、耐擦傷性、密着 性などの物理的的強度にも優れ、安価で、生産性に優れ たコーティング組成物を提供することを目的とする。

【解決手段】下記の一般式(1)M(OR)n(MはT i, Ta, Zr, In, Znのいずれか1種の金属、R はアルキル基、nは金属の酸化数)で表せられる金属ア ルコキシドおよびその加水分解物と、下記の一般式

(2) R'x Si(OR) y (Rはアルキル基、R'は 末端にビニル基、アクリロイル基、メタクリロイル基な どの重合可能な不飽和結合を有する官能基、γは金属の 酸化数、x は0 < x < y の置換数)で表せる有機ケイ素 化合物およびその加水分解物を主成分とするコーティン グ組成物である。

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】下記の一般式(1)

M(OR)n

(MはTi, Ta, Zr, In, Znのいずれか1種の 金属、Rはアルキル基、nは金属の酸化数)で表せられ る金属アルコキシドおよびその加水分解物と、下記の一 般式(2)

1

## $R' \times S i (OR) y$

(Rはアルキル基、R'は末端にビニル基、アクリロイ ル基、メタクリロイル基などの重合可能な不飽和結合を 有する官能基、 y は金属の酸化数、 x は0< x < y の置 換数)で表せる有機ケイ素化合物およびその加水分解物 を主成分とする高屈折率コーティング組成物。

【請求項2】前記コーティング組成物の中に、さらに、 分子中に少なくとも2個以上のイソシアネート基を有す るイソシアネート化合物が含まれてなることを特徴とす る請求項1記載の高屈折率コーティング組成物。

【請求項3】前記イソンシアネート化合物が、ヘキサメ チレンジイソシアネート(HDI)の変性体であって、 平均分子量が500~3000であることを特徴とする 請求項2記載の高屈折率コーティング組成物。

【請求項4】前記コーティング組成物の中に、さらに、 OH価が15~400を有し、平均分子量が3000~ 30000のポリオール樹脂が含まれてなることを特徴 とする請求項1乃至3記載の何れかの高屈折率コーティ ング組成物。

【請求項5】前記コーティング組成物の中に、さらに、 平均粒径1~50nmの結晶性の酸化チタン、酸化ジル コニウム、酸化亜鉛、酸化インジウムから選ばれる高屈 折超微粒子が含まれてなることを特徴とする請求項1乃 30 成することで課題を解決できることを見出し、本発明に 至4記載の何れかの高屈折率コーティング組成物。

## 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、高屈折率コーティ ング組成物に関するもので、さらに詳しくは、ガラスや プラスチックなどの透明基材などに塗工して、反射防止 膜、選択透過膜、あるいは吸収膜などの光学多層膜を形 成可能な高屈折率コーティング組成物に関する。

## [0002]

【従来の技術】従来、ガラスやプラスチックなどの基材 に、酸化チタンや酸化ケイ素などの無機酸化物薄膜を蒸 着法、あるいはスパッタ法などのドライコーティングに よって形成して反射防止膜などの光干渉による光学多層 膜を形成する方法が知られている。しかし、このような ドライコーティングプロセスでは、装置が高価で、成膜 速度が遅く、生産性が高くないなどの課題を有してい る。これに対して、金属アルコキシドなどを出発組成物 とし、基材に塗工して光学多層膜を形成する方法が知ら れており、高屈折率材料としてはTiやZrなどのアル コキシドを用いる方法が提案されている。しかし、これ 50

らの塗膜では、乾燥、重合に高温、長時間を必要とする ため生産性に問題がある。また、ある程度の高い屈折率 を得ることはできるが、硬度や耐擦傷性、基材との密着 性などの物理的強度が不十分であり、光学多層膜は最外 層に使用されるため、強度が不十分では実用に耐えるこ とができないといった欠点を有している。

【0003】これらを改善するために、特開平8-29 7201号公報に記載されているように、金属アルコキ シドとアクリル化合物との複合材料などが提案されてい る。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、これら の複合膜組成物は、硬度や耐擦傷性などの物理的強度を 向上させようとするとアクリル系モノマー成分比率を高 める必要があり、光学特性を決定するTi系などのアル コキシドを出発組成物とする高屈折率酸化物の体積比が 抑制され高屈折率化をはかることができないという欠点 を有し、高屈折率化と硬度、耐擦傷性、密着性などの物 理的強度特性が両立できる組成物は見出されていない。

【0005】そこで、本発明は、高い屈折率を有し、か つ硬度、耐擦傷性、密着性などの物理的的強度にも優 れ、安価で、生産性に優れたコーティング組成物を提供 することを目的とする。

#### [0006]

20

【課題を解決するための手段】上述の課題を達成すべく 検討した結果、Tiなどの金属アルコキシドとアクリロ イル基を有する有機ケイ素化合物を主成分として、ヘキ サメチレンジイソシアネート(HDI) などの変性体に 代表されるイソシアネート化合物のハイブリッド膜を形 至ったものである。

【0007】即ち、請求項1記載の発明は、下記の一般 式(1)

#### M(OR)n

(MはTi, Ta, Zr, In, Znのいずれか1種の 金属、Rはアルキル基、nは金属の酸化数)で表せられ る金属アルコキシドおよびその加水分解物と、下記の一 般式 (2)

## $R' \times S i (OR) y$

(Rはアルキル基、R'は末端にビニル基,アクリロイ ル基、メタクリロイル基などの重合可能な不飽和結合を 有する官能基、yは金属の酸化数、xは0<x<yの置 換数)で表せる有機ケイ素化合物およびその加水分解物 を主成分とするコーティング組成物である。

【0008】請求項2記載の発明は、請求項1記載の高 屈折率コーティング組成物において、前記コーティング 組成物の中に、さらに、分子中に少なくとも2個以上の イソシアネート基を有するイソシアネート化合物が含ま れてなることを特徴とする。

【0009】請求項3記載の発明は、請求項2記載の高

屈折率コーティング組成物において、前記イソンシアネート化合物が、ヘキサメチレンジイソシアネート(HDI)の変性体であって、平均分子量が500~3000であることを特徴とする。

【0010】請求項4記載の発明は、前請求項1乃至3記載の何れかの高屈折率コーティング組成物において、記コーティング組成物の中に、さらに、0H価が15~400を有し、平均分子量が3000~3000のポリオール樹脂が含まれてなることを特徴とする。

【0011】請求項5記載の発明は、請求項1乃至4記載の何れかの高屈折率コーティング組成物において、前記コーティング組成物の中に、さらに、平均粒径1~50nmの結晶性の酸化チタン、酸化ジルコニウム、酸化亜鉛、酸化インジウムから選ばれる高屈折超微粒子が含まれてなることを特徴とする。

【0012】<作用>本発明によれば、Tiなどの金属 アルコキシドとアクリロイル基含有の有機ケイ素化合物 とを主成分とすることで、一般式(1)の金属アルコキ シドの加水分解生成物による高屈折率化に寄与する酸化 物成分の生成と、一般式(1)および(2)の有機金属 化合物のアルコキシ基の加水分解によるM-O-Si結 合の複合酸化物ネットワークが生成され、被膜形成後に UVあるいはEB照射することで、被膜中のアクリロイ ル基などの重合可能な不飽和結合基による架橋も生成さ せることでき加熱重合と光(EB)重合による複合架橋 により、架橋密度が高くでき、分子レベルで均一な構造 を呈しているためTiなどの高屈折率化成分の体積比が 大きくても充分な強度を発揮できるものである。上記コ ーティング組成物にさらに分子中に少なくとも2個以上 のイソシアネート基を有するイソシアネート化合物を加 えることで、コーティング組成物の加水分解物のOH基 とイソシアネート化合物のイソシアネート基との反応に よるウレタン結合ネットワークの生成によるハイブリッ ド構造が形成され、より硬度が高く、耐擦傷性も良好 で、従来のコーティング剤の欠点を大幅に改善すること ができ、高屈折率化と物理的強度向上の両立可能な組成 物を提供するものである。なかでも、イソシアネート化 合物を分子量が大きなウレタンプレポリマーではなく、 副生成物の水やアルコールなどとの反応性が低く、低分 子量であるHDIのTMPアダクト体などとすること で、コーティング組成物としてある程度安定度で可使時 間を長くすることができ、より均質で架橋密度の高いハ イブリッド膜を形成することができる。さらに上記ハイ ブリッド膜と相溶性、反応性の高いポリオールや高屈折 率化、高強度化できる結晶性の無機超微粒子を加えるこ とで塗工性、密着性、物理強度の向上などに優れるコー ティング組成物とすることができるものである。

## [0013]

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態について詳細 に説明する。 【0014】本発明のコーティング組成物は、Tiなどの金属アルコキシドとアクリロイル基を有する有機ケイ素化合物およびその加水分解物を主成分として、さらに分子中に少なくとも2個以上のイソシアネート基を有するイソシアネート化合物とが含まれるコーティング組成物からなるものであり、これを基材に塗工し、加熱乾燥し、被膜を形成した後、UVなどの光照射を施すことで高屈折率被膜を形成可能とするものである。

【0015】コーティング材料に含まれる各成分について以下に詳述する。本発明において用いられる、Tiなどの金属アルコキシドは、下記の一般式(1) M(OR)n

(MはTi, Ta, Zr, In, Znのいずれか1種、Rはアルキル基、nは金属の酸化数)で表せられるものであり、テトラ-isoープロピルチタネート、テトラ-nーブチルチタネート、テトラーnーブチルジルコネートなどが例示される。一方、アクリロイル基などを有する有機ケイ素化合物は、下記の一般式(2) R'x Si (OR) v

(Rはアルキル基、R'は末端にビニル基,アクリロイ ル基、メタクリロイル基などの重合可能な不飽和結合を 有する官能基、 y は金属の酸化数、 x は0< x < y の置 換数)で表せるもので、ビニルトリメトキシシラン、ア クリロキシプロピルトリメトキシシラン、メタクリロキ シプロピルトリメトキシシランなどが例示される。これ らの有機金属化合物は、特に限定されるものでなく、2 種以上組み合わせても何ら差し支えなく、金属アルコキ シドとアクリロイル基含有有機ケイ素化合物が併用して あれば好適である。これらの有機金属化合物はコーティ ング組成物中に、p-トルエンスルホン酸などの有機酸触 媒を含有させることで、塗工後に大気中の水分でもって 加水分解反応させて被膜形成しても良いし、また予め水 (塩酸などの触媒を含む)を添加し、加水分解反応させ たものを用いることもできる。予め水を添加する際に、 有機金属化合物の加水分解物が、該有機金属化合物の全 アルコキシル基を加水分解させるのに必要な水の量より も1/8~7/8の量の水で部分加水分解されたもので あるとすることで安定な組成物を得ることができ、余分 な水を残すことなく特別な分離精製せずに用いることが 40 できる。上記の調整は、イソシアネート化合物と余分な 水との副反応を抑制したり、金属化合物の加水分解率を コントロールして、金属化合物ポリマーの成長を抑制し たり、イソシアネートとの相溶性を高めることで、相分 離を抑制し均質で分子架橋密度が高く、分子レベルのハ イブリッド膜を形成至らしめるものである。

【0016】また、イソシアネート化合物は、その分子中に2個以上のイソシアネート基(NCO基)を有するものであって、例えばトリレンジイソシアネート(以下TDIと記す)、キシリレンジイソシアネート(以下XDIと記す)、ヘキサメチレンジイソシアネート(以下

6

HDIと記す)などのジイソシアモノマー類と、これらのモノマー類のアダクト体、ビューレット体、トリマーなどの変性体、および誘導体、ポリオールなどと一部反応させたプレポリマーなどが使用できる。なかでも、有機金属化合物の加水分解物と相溶性が良く、被膜形成時に相分離することなく、架橋密度の高い、均質で透明なハイブリッド被膜が形成できるのは、HDIのTMPアダクト体、HDIのビューレット体、HDIトリマーなどの分子量500~3000低分子量の変性体が適している。これらの変性体はウレタン硬化剤として使用されてもので、毒性も低く汎用品として使用されており、安価である。

【0017】上記有機金属化合物とイソシアネート化合物の系では、被膜の架橋密度が高過ぎたり、可とう性に欠けたり、塗工直後の表面タック(粘着性)が残る場合があり、塗膜の塗工性や安定性を考慮してイソシアネートと反応性を有するポリオール樹脂を加えることができる。コーティング組成物中に加えるポリオールはポリエステル系、ポリアクリル系、シリコーン変性アクリルポリオールなど特に限定されるものではないが、〇日価15~400を有し平均分子量が3000~3000のポリオールが架橋性、塗工性、相溶性などから好適である。

【0018】さらに、平均粒径1~50nmの結晶性の酸化チタン、酸化ジルコニウム、酸化亜鉛、酸化インジウムから選ばれる高屈折超微粒子を添加することができる。これらの微粒子を添加する技術は公知ではあるが、本発明のハイブリッド系組成物との組み合わせは、単なる組み合わせではなく、マトリックスであるコーティング組成物の無機のネットワークと無機フィラーとの相溶性、親和性が高く、単に有機樹脂中に分散するより、より良い分散状態、フィラーとマトリックスとの密着性が高い被膜が得られ、通常の添加効果よりも高い効果が得られるものである。

【0019】UV照射による硬化を行う際には、ラジカル重合開始剤を添加すると好適であり、ベンゾインメチルエーテルなどのベンゾインエーテル系開始剤、アセトフェノン、2、1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、などのアセトフェノン系開始剤、ベンゾフェノンなどのベンゾフェノン系開始剤が挙げられるが、特に限定されるものではない。上述した各成分をいくつか組み合わせてコーティング組成物に加えることができ、さらに、物性を損なわない範囲で、分散剤、安定化剤、粘度調整剤、着色剤など公知の添加剤を加えることがもできる。

【0020】コーティング組成物の塗布方法には、通常用いられる、ディッピング法、ロールコティング法、スクリーン印刷法、スプレー法など従来公知の手段が用いられる。被膜の厚さは目的の光学設計にあわせて、液の50

濃度や塗工量によって適宜選択調整することができる。 【0021】本発明の高屈折率コーティング材料は、ガラスやプラスチックフィルムなど特に限定されるものではなく、さらに必要に応じて各種ハードコート剤、低屈折率材料、セラミック蒸着膜と積層することが可能で、また本発明の組成比を変えて積層することも可能である。

【0022】本発明のコーティング組成物を具体的な実施例をあげて説明する。

#### 10 [0023]

(4)

20

【実施例】表面にUV硬化樹脂HC層( $5\mu$ m)を設けた80 $\mu$ m厚のTACフィルムを基材として、下記組成の材料を表1に示す割合になるように組み合わせて調液してコーティング組成物を作成、UV硬化の開始剤としてアセトフェノン系開始剤を重合成分に対して2%添加した。バーコーターにより塗布し、乾燥機で100℃ー1min乾燥し、高圧水銀灯により1、000mJ/cm2の紫外線を照射して硬化させ、光学膜厚(nd=屈折率n\*膜厚d(nm))がnd=550/4nmになるよう適宜濃度調整をして高屈折率被膜を形成し、各種試験用の試験体を得た。

【0024】本発明の実施例  $1 \sim 3$  の試験体及び比較例 としてメタクリロキシシランを含まない系(比較例 1)とTiPルコキシドと2 官能アクリル化合物との2 成分系(比較例 2)の試験体を合わせて作成した。各々の実施例及び比較例の下記のコーティング組成物の各成分の配合比は表 1 に示した。

【0025】<コーティング組成物の各成分>

- (A) テトライソプロポキシドチタネートとメタクリロ 30 キシプロピルトリメトキシシランを表 1 に示す配合になるように所定量混合し、混合物 1 molに対して 0. 1 N の塩酸 2 mol とイソプロピルアルコールと酢酸エチル混合溶媒(5 0 / 5 0 w t %)を混合し、室温で 2 時間攪拌反応させた、複合ゾル。各成分の比率は A 1 を酸化チタン成分、A 2 をその他の成分比とした。
  - (B) HDIのTMPアダクト体(市販ウレタン硬化剤)を酢酸エチルで希釈溶液。
- (C) H価130、平均分子量10000、Tg88 ℃の市販アクリルポリオール樹脂の溶液。(酢酸ブチ 40 ル、酢酸エチル混合溶剤)
  - (D) 市販のウレタンアクリル樹脂(平均分子量3000の2官能)。各溶液は固形分は3wt%になるように希釈調整した。

【0026】上記で得られた試験体は、下記の評価方法 にて評価した。

## <評価試験>

(1) 光学特性

分光光度計により入射角 5 ° で 5 5 0 n mにおける反射率を測定した。

(2)密着性

塗料一般試験法 I I S - K 5 4 0 0 のクロスカット密着 試験方法に準じて塗膜の残存数にて評価した。

#### (3)鉛筆硬度

塗料一般試験法 J I S – K 5 4 0 0 の鉛筆引っかき値試 験方法に準じて塗膜の擦り傷にて評価した。

\*スチールウール#0000により、250g/cm<sup>2</sup>の 荷重で往復5回擦傷試験を実施、目視による傷の外観を 検査した。

[0027]

【表1】

## (4) 耐擦傷試験

		実施例 1	実施例2	実施例3	比較例 1	比較例2	
配 合 比 (wt%)	A1	65	65	65	65	65	
	A2	35	25	20			
	В		10	10	20		
	С			5	15	_	
	D				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	35	
反射率 (%)		13.3	12.9	13.2	13.0	12.8	
密着性		1.00	98	100	100	100	
鉛筆硬度		3H	3 H	3 H	Н	2H	
<b>新擦傷性</b>		0	0	0	×	Δ	

\*

(5)

A1:酸化奶成分

A2: メタクリロキンプロピルトリメトキンシラン成分

B:HDI-TMP79 外体 C: アクリムポリオール樹脂 D:かなアクリル機能

耐擦傷性: ◎傷なし、○かるく傷あり、△かなり傷つく、×著しく傷つく

【0028】表1に示すように、いずれも反射率が約1 3%と高く、(被膜の屈折率はおおよそ1.8であっ た) 目的の高屈折率層を得ることができた。本発明のコ ーティング組成物を用いた被膜は、密着性、硬度、耐擦 傷性にも優れる。比較例は、いずれも強度面で特性が劣 っていることがわかる。

### [0029]

グ組成物は、M-O-Siの複合金属酸化物架橋と、ア クリル基の架橋およびウレタン架橋を有し、金属酸化物 と有機化合物の分子レベルのハイブリッド構造を呈した

被膜を形成できるものであり、高屈折率という光学特性 と物理的強度特性とを兼ね備えた被膜を形成することが できるものである。すなわち、ディスプレイの反射防止 膜などの部材の最外層に形成されても、過酷な環境や、 取り扱いにも充分に耐えられる被膜を形成することがで き、蒸着などと比べ装置コストも比較的安価で、成膜 (塗工) 速度も10倍以上で生産性も高く、製造も容易 【発明の効果】以上述べたように、本発明のコーティン 30 である。また、本発明のコーティング組成物の被膜は、 光照射などで硬化するため、低温での塗工が可能なの で、フィルムなどに巻き取り塗工で作成することが可能 で安価に、大量生産できるといった効果を奏する。